(B) 日本国特許庁(JP)

④実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U) 昭62-156362

⑤Int Cl.

識別記号

广内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)10月5日

B 05 B 3/06

Z - 7639 - 4F

審査請求 有 (全 頁)

図考案の名称 噴霧ノズル

> 到実 顧 昭61-43995

多出 顧 昭61(1986)3月27日

珍考 案 者 米 原

隆 東村山市恩多町 5 - 26-3

句出 願 人 原 米

隆 東村山市恩多町 5 - 26-3

珍代 理 人 弁理士 藤沢 正則 外1名

- 4 考案の名称 噴霧ノズル
- 2 実用新案登録請求の範囲

噴霧装置から導出したバイブの先端に、このバイブを軸とした回転自在な回転体を設け、この回転体に上記パイプ内の噴射路と連絡された噴射イド路を設け、このガイド路は軸から放射にはないで、その先端開口部が、噴射による反動によって回転体が回転する方向に形成した噴射口となっていることを特徴とする噴霧ノズル。

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この考案は適宜の液体、粉末等を噴霧するスプレーその他の噴霧装置の噴霧ノズルに関するものである。

(従来の技術)

従来のスプレーはガス及び液体に圧力を加えるか又は液体そのものに圧力を加えることにより小さな噴射穴から噴霧している。

(2)

(考案が解決しようとする問題点)

しかしながらこの従来のスプレーは噴霧される 粒径が不整いとなり、かつ噴霧の中心箇所が噴霧 が強く、その周囲が弱いため適宜物に噴霧すると 不均一な塗布となる。また近距離から広範囲に始 一に塗布することはできなかった。広範囲に塗布 できるようにするため噴射穴を小さくすると噴霧 粒径が極端に小さくなり、この場合液滴も出たり、 また目詰りも多くなり、加工も面倒である。

(問題点を解決するための手段)

この考案はこれらの欠点を除去するために為されたもので、ノズルの噴射圧による反動で、軸を中心に噴射孔を回転させ乍ら噴霧させるものである。

そしてこの考案の構造は噴霧装置から導出した バイブの先端に、このバイブを軸とした回転自在な回転体を設け、この回転体に上記パイプ内の噴射路と連絡された噴射ガイド路を設け、このガイド路は軸から放射状に伸び、その先端開口部が、噴射による反動によって回転体が回転する方向に 形成した噴射口となっているものである。

(作用)

而して噴霧装置を作動させると、液体がパイプの関射の関射が関射がある。するとで噴射が見から噴霧される。またで噴射の原射により上記パイプを軸として噴射を回転が回転が回転が回転によって向からで噴射が回転によって向けらいで変数のなりでである。 で噴霧装置を作動させると、液体がパイプの関射が回転が見かれる。またで噴霧が回転によって向からで噴霧が回転によって分散されるで増が回転によって分散されるで噴射が回転によって分散されるで噴霧である。

(実施例)

以下この実施例を図について説明する。第/図乃至第3図はこの考案の第/実施例を示し、1は 噴霧する液体及びフロンガスを入れたポンベ、2 はこのポンベ1の一個から突出した押圧パイプ、 3はこの押圧バイブ2の先端に設けた取付基体、 4はこの取付基体3の一側から突出した軸で、この軸4の先端には鍔部4aが設けられている。5

この実施例の場合取付基体3を手で押し、押圧パイプ2を押すと、ポンペ1内の液体及びフロンガスが押圧パイプ2内を通り、噴射路5を通って回転体6の噴射ガイド路8に至り、その噴射圧のaから勝となって噴霧する。そしてこの噴射圧の反動によって回転体6は軸4を中心に第2図の矢

印に示す如く回転する。従って上記噴射口 8 a は回転し乍ら噴霧し、その被噴霧軌跡は第 4 図に示す如く大きな環状円形 P となる。

またこの実施例において回転体 6 下面の噴射口8 a は、第 2 図の回転体 6 の外周円の略接線方向に限らず、第 3 図に示す如く、噴射ガイド路 8 に対し8 a * の位置か 8 a * の位置まで変更することができ、これらのものは上記噴射圧の反動によって回転体 6 が回転する。噴射口 8 a * の複写動における環状円形 P'となる。 被噴霧軌跡環状円形 P'となる。

第5図乃至第7図はこの考案の第2実施例を示し、取付基体3から垂下する軸4の下端に、回転基体9を回転自在に設け、かつこの回転基体9の相対する側面からパイプ10を突設し、上記回転基体9の凹部11に嵌めた軸4の噴射ガイド路12を回転を対向させて噴射ガイド路12を回転基体9及びパイプ10に設け、この噴射ガイド路12の先端の噴射口12aをパイプ10の両先端に設けたもので、これらの二つの噴射口12aは第5図に示す

如く対称に斜下方に傾き、かつ第6図に示す如く、 そのパイプ10の両先端が回転基体9を中心に対称 に折り曲げられている。

この実施例の場合、コンプレッサー等を用いた 適宜の噴霧装置のバイブの先端に取付基体3を取り付け、噴霧装置を作動させると二つのバイブ10 の先端の噴射口12aから粒体が噴射し、この噴射 圧の反動で回転基体9及びバイブ10が第7図の矢 印方向に、軸4を中心に回転する。

第8図はこの第2実施例のものをスプレープラシに応用したものであり、スプレーホルダー15の一端に環状基体16を設け、この環状基体16の下面に環状にブラン17を植毛し、このスプレーホルダー15内に収納したスプレーボンペの押圧パイプ18の先端に取付基体3を固定し、回転基体9及びバイブ10を上記プラシ17の中空部19に位置せしめたものである。

この場合取付基体3を手で押すと、回転基体9 が回転し乍らパイプ10先端の喚射口12aから噴霧 され、噴霧粒子は環状のブラシ17の内間面にまん べんなく付着し、スプレーホルダー15を手で持ってブラシ17をこすると、被処理面に噴霧粒子の液化物が付着する。従ってスプレーボンベ内の液体が帯電防止剤であれば、被処理面にブラシ17を介して帯電防止剤から成る極薄膜を付着、形成することができる。

また第9図は上記第/実施例の単なる変形であるこの考案の第3実施例を示し、ハンドル20をポンベ1側に押すことにより押圧バイブ2がポンベ1内に入り噴射口8から噴霧しつつ回転体6が回転する。

以上の如く回転体に設けた噴射口或いは回転基体から突出させたバイブ先端に設けた噴射口の形成方向は、噴射圧による反動で回転体或いは回転基体を回転せしめるものであれば任意の方向でよい。

この場合回転体或いは回転基体の接線方向に噴射口が向いているのが回転力が最大となるが、さらにこの回転力は回転体或いは回転基体の中心軸から噴射口までの距離 ℓ (第5 図で図示)に比例

: 1

(8)

し、また順射圧が大ければ、反動力が大きく、回転体域回転基体の回転速度が増す。また上記実施例では噴射口を対称位置に二つ設上でもよいである。は噴射口は一個でもよくまた三個以上でもは取りでもよりである。は一個でもなりでは、またないが噴射口の方向を第3回の8a'に示る。成型したもの考案の材質としてはブラスチックをである。である。では金属で成型したもの等適宜のものである。使用できる。

(考案の効果)

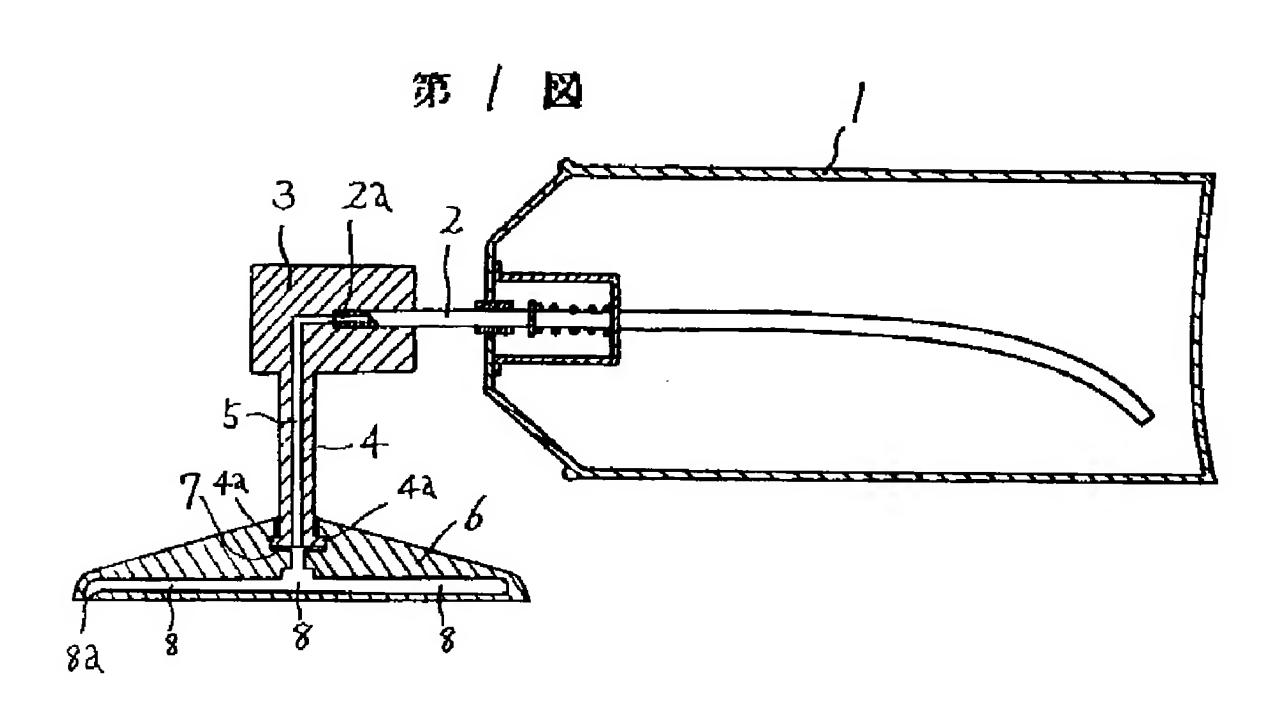
この考案は以上の如く噴霧装置を作動させると 噴射口から多数の粒子が噴霧すると同時に噴射口 がこの噴射圧の反動で回転する。これにより被噴 霧面積が広がる。しかも噴射口が常に回転し作ら、 噴射方向と反対方向に移動するため噴射された粒 子の噴射圧は弱まり、やわらかい雰囲気の噴霧が 行われる。これらにより被噴霧物への噴霧が近距 離から広範囲に均一に塗布することができる。 4 図面の簡単な説明

第/図はこの考案の第/実施例を示す断面側面図、第2図は同じく第/実施例の回転体の底面図、第3回は同回転体の噴射口を変化せしめた際の噴射軌跡との関係を示す説明底面図、第4図はこの考案の被噴射面の噴射軌跡を示す説明図、第5図はこの考案の第2実施例を示す断面正面図、第6図は同側面図、第7図は同底面図、第8図は第2実施例のものをスプレープランに応用した一部断面側面図、第9図はこの考案の第3実施例を示す一部断面正面図である。

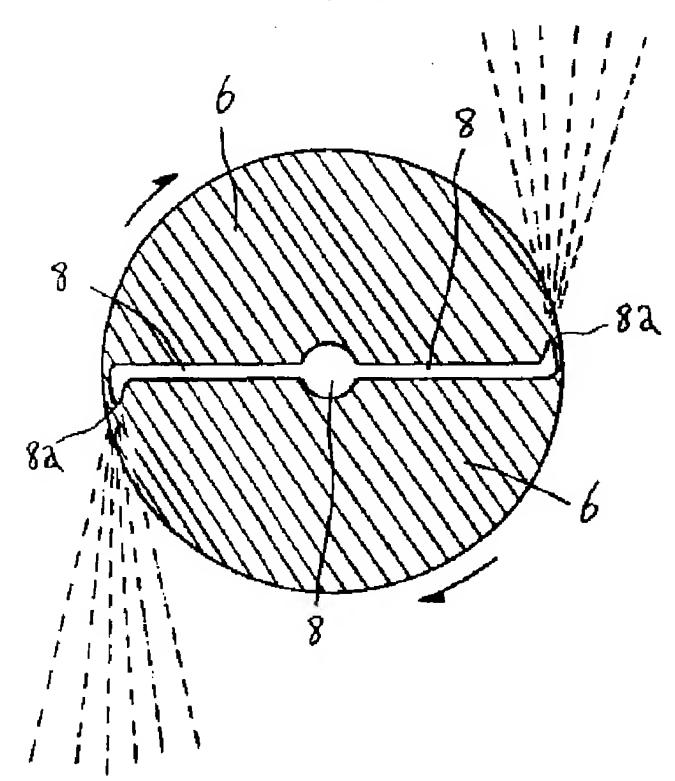
4字加义

なお図中1はボンベ、2は押圧パイプ、3は取付基体、4は軸、5は噴射路、6は回転体、8は噴射ガイド路、8aは噴射口、9は回転基体、10はパイプ、12は噴射ガイド路、12aは噴射口である。

実用新案登録出願人 米 原 隆 代 圳 人 弁理士 藤 沢 正 剃, 代 理 人 弁理士 藤 沢 則 昭

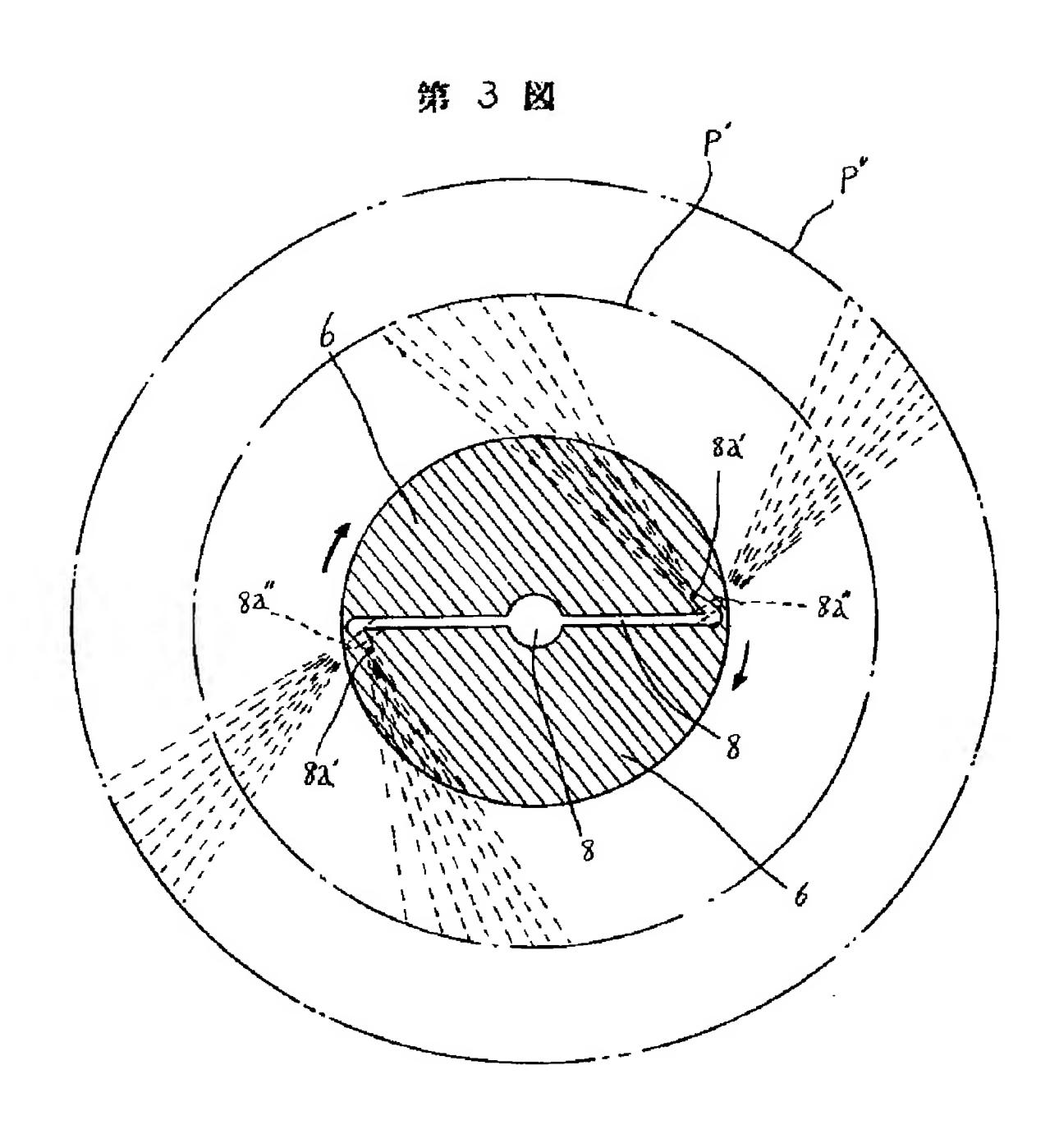


第2网



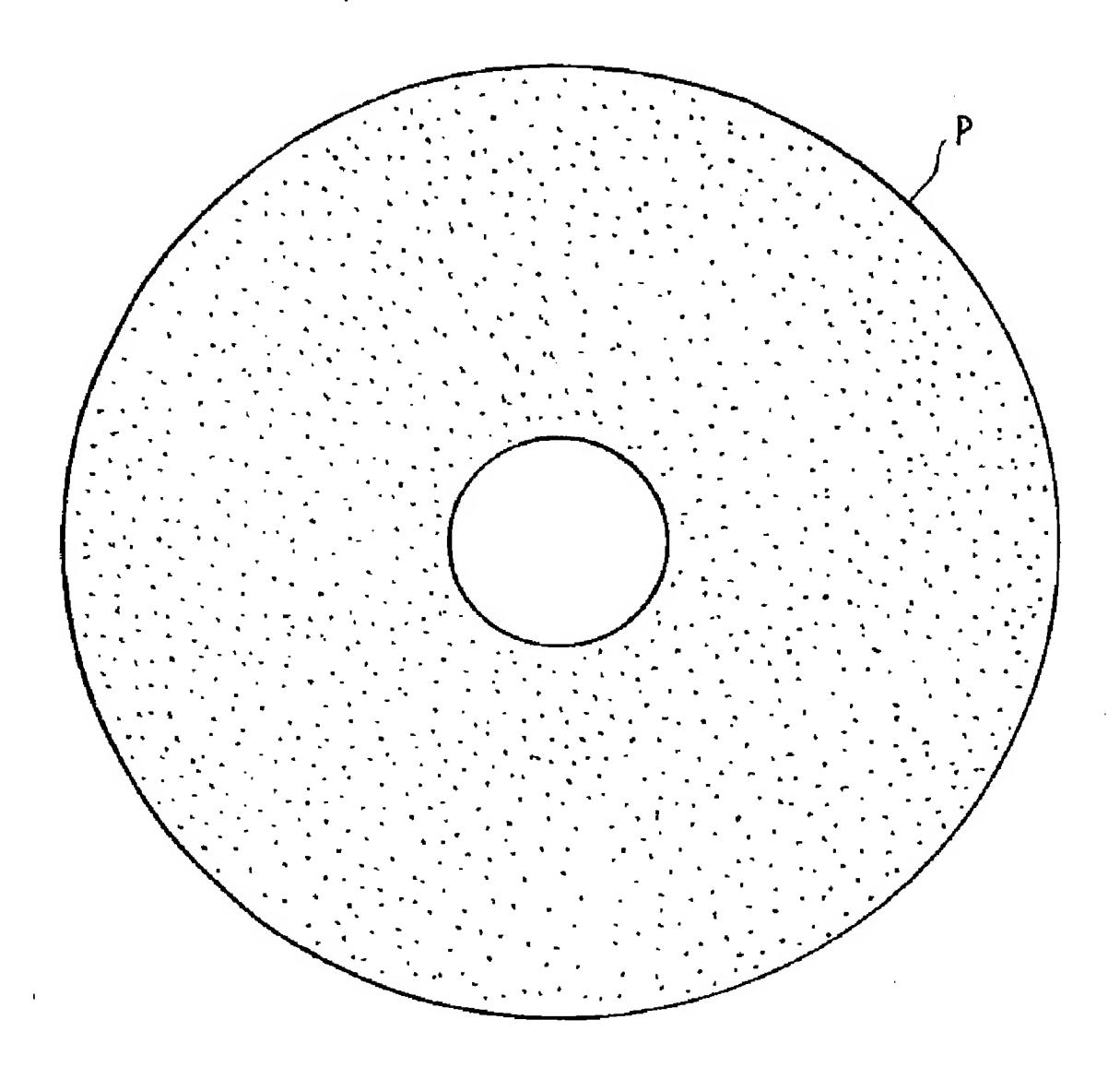
実用新案登録出願人 代理人 弁理士

米原隆縣汉月別

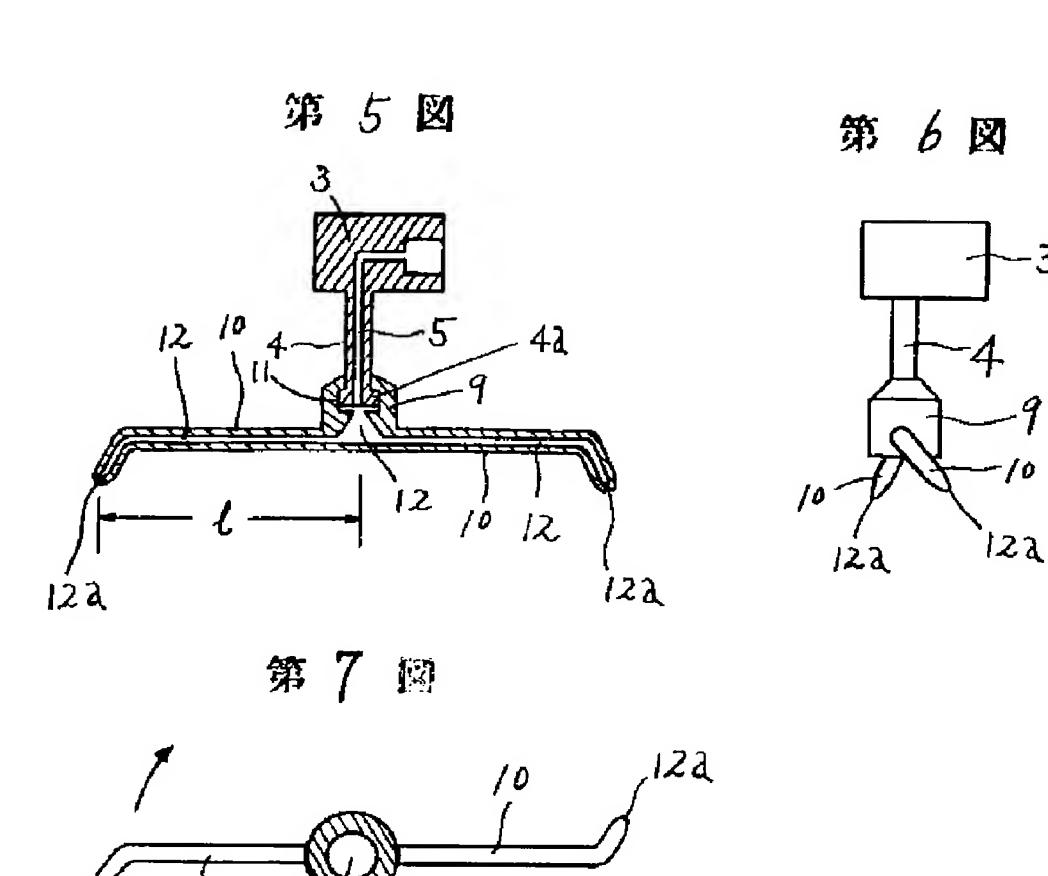


实服新案登録出願人 米 原隆 代理人 弁理士 藤 沢 正 則 (外 1名)

第 4 凶

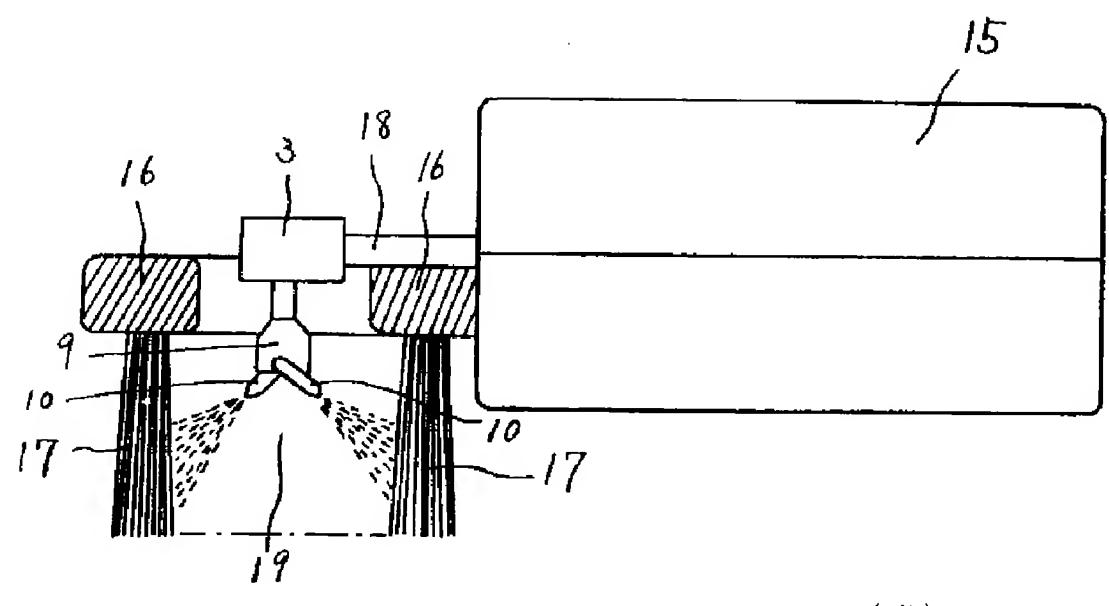


实用新案登録出願人 代理人 弁理士



12a

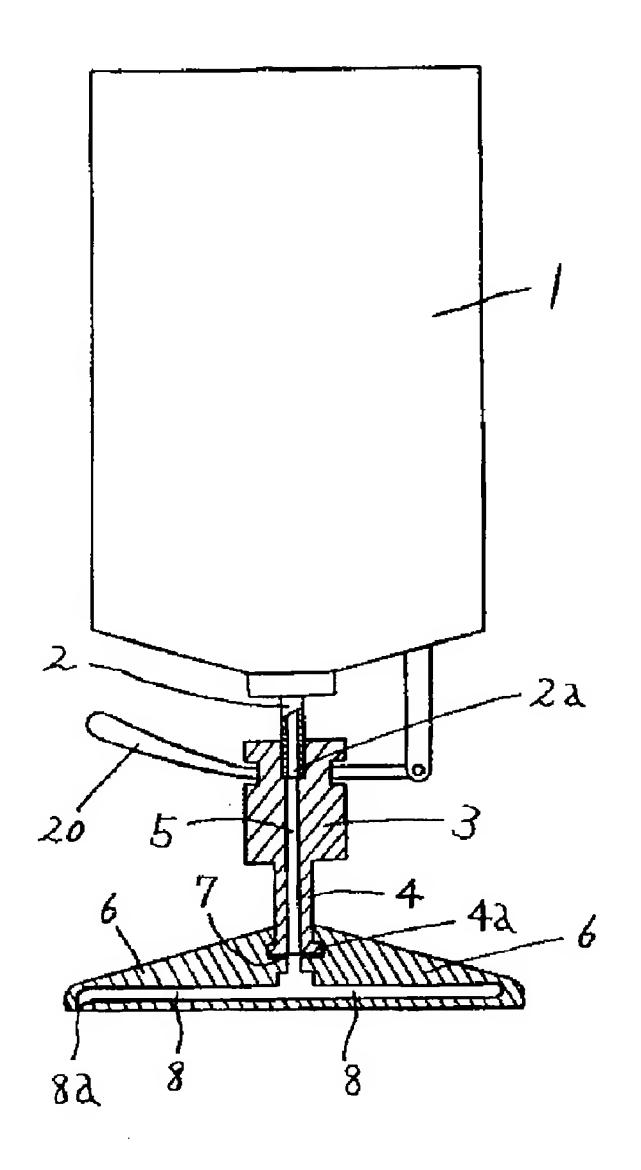




实用新来登録出願人 米原代理人 弁理士 藤沢

米原理

第9四



寒朋新菜登録出願人 代理人 弁理士 米原隆縣 深即(外局)